

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成30年5月10日(2018.5.10)

【公開番号】特開2016-200537(P2016-200537A)

【公開日】平成28年12月1日(2016.12.1)

【年通号数】公開・登録公報2016-066

【出願番号】特願2015-81884(P2015-81884)

【国際特許分類】

G 0 1 N 23/223 (2006.01)

【 F I 】

G 0 1 N 23/223

【手続補正書】

【提出日】平成30年3月26日(2018.3.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 2 6 】

測定用基板 1 2 の結晶構造におけるカット面が分かっていない場合、まず、制御装置 6 0 が搬送装置 5 0 を制御して、カセット 3 に収納された測定用基板 1 2 を蛍光 X 線分析装置 4 0 の導入室のカセット 4 7 へ搬送させる。次に、制御装置 6 0 が搬送手段 4 6 および蛍光 X 線分析装置 4 0 を制御して、測定用基板 1 2 を r ステージ 4 8 へ搬送させて載置し、測定用基板 1 2 を測定用基板 1 2 の中心軸心周りに ステージによって時計方向に 3 6 0 ° 回転させながら 1 次 X 線 4 3 として W - L 1 を照射させ、測定用基板 1 2 から発生する回折 X 線の強度を測定用基板 1 2 の回転角度 と対応させた回折パターンを測定させて記憶する。そして、制御装置 6 0 が、記憶した回折パターン(図 3)について、所定の X 線強度比 (W - L / S i - K) 以下の X 線強度比が所定の角度範囲、例えば、 3 ° ~ 5 ° にわたって存在していると、この所定の角度範囲の中心角度位置を回折 X 線回避角度として記憶する。この回折 X 線回避角度は、例えば、7 5 °、1 1 5 °、1 8 5 °、2 7 0 °、3 5 0 ° などである。